

# スピン注入によるナノ磁石の磁化反転制御

## 技術情報

- ・磁化反転装置、記憶素子、及び磁界発生装置(PCT/JP2010/061693)
- ・出願者: 国立大学法人 九州大学

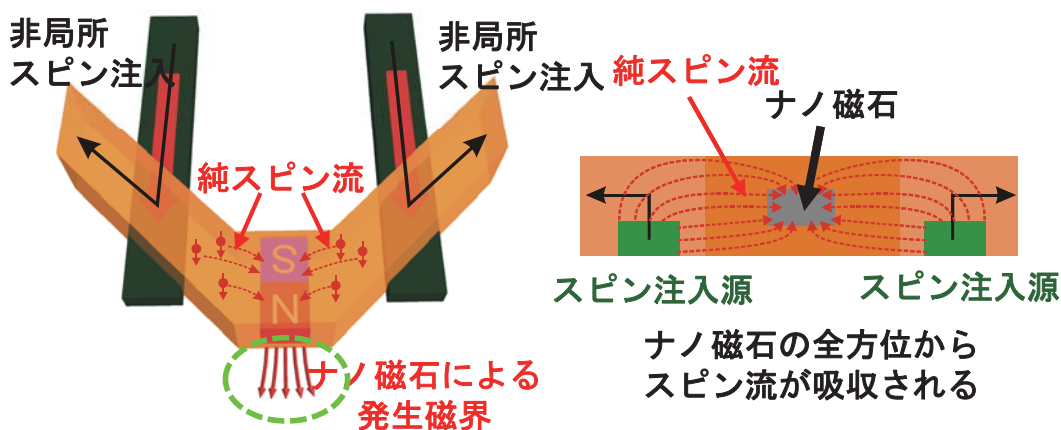
ココがすごい!



ナノ磁石に多方向からスピン注入し、スピン侵入長に制限されない磁化反転が可能

## 技術概要

- ・積層構造ではなく、面内構造を適用することで、電荷を排除したスピン(純スピン流)の注入が可能
- ・多方向からスピン注入することで、厚さ数十nmの厚膜ナノ磁石のスピン注入磁化反転が可能
- ・ナノ磁石の厚膜化により、極微スピンドバイスにおける熱安定性や発生磁界の低下等の問題を克服



【応用例・活用分野 等】

- ・磁性 RAM などの次世代スピントロニクス素子の磁化状態制御
- ・磁気記録ヘッドなど情報記憶装置

【企業様へのメッセージ】

- ・興味を持たれた方は、是非ご一報下さい。

## 連絡先

機関名: (株)産学連携機構九州 ( 九大TLO )

所在地: 福岡市東区箱崎6-10-1 九州大学ベンチャービジネスラボラトリ3階

担当部署: 知的財産部

電話番号: 092-643-9467

FAX: 092-642-4365

E-mail: home@k-uip.co.jp

HP: <http://www.k-uip.co.jp>